

488696-2026 - Javni razpis

Irska – Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Education Procurement Service (EPS)

E-naslov: info@educationprocurementservice.ie

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifikator postopka: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

2.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): South-East (IE052)

Država: Irska

2.1.3. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 4

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Notranji identifikator: 1

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): South-East (IE052)

Država: Irska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 48 Meseci

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: angleščina

Jeziki, v katerih so neuradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (ali njihovi deli): angleščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 180 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja:

Še ni znano

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: The High Court of Ireland

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila:
Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: The High Court of Ireland

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Notranji identifikator: 2

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): South-East (IE052)

Država: Irska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 48 Meseci

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: angleščina

Jeziki, v katerih so neuradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (ali njihovi deli): angleščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 180 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Še ni znano

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: The High Court of Ireland

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: The High Court of Ireland

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Notranji identifikator: 3

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): South-East (IE052)

Država: Irska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 48 Meseci

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: angleščina

Jeziki, v katerih so neuradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (ali njihovi deli): angleščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 180 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja:

Še ni znano

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: The High Court of Ireland

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Education Procurement Service (EPS)
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: The High Court of Ireland
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Education Procurement Service (EPS)
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Sklop: LOT-0004

Naslov: Plasma Deposition ,PECVD

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Notranji identifikator: 4

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): South-East (IE052)

Država: Irska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 48 Meseci

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: angleščina
Jeziki, v katerih so neuradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (ali njihovi deli): angleščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 180 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Še ni znano

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: The High Court of Ireland

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: The High Court of Ireland

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Education Procurement Service (EPS)

Registrska številka: IE 6609370 G

Poštni naslov: Castletroy Limerick

Mesto: Limerick

Poštna številka: V94 DK53

Podregija države (NUTS): Mid-West (IE051)

Država: Irska

E-naslov: info@educationprocurementservice.ie

Tel.: 000

Spletni naslov: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil kupca: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0002

Uradno ime: The High Court of Ireland

Registrska številka: The High Court of Ireland

Služba: The High Court of Ireland

Poštni naslov: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Mesto: Dublin

Poštna številka: D07 WDX8

Podregija države (NUTS): Dublin (IE061)

Država: Irska

E-naslov: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Tel.: +353 1 8886000

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0003

Uradno ime: European Dynamics S.A.

Registrska številka: 002024901000

Služba: European Dynamics S.A.

Mesto: Athens

Poštna številka: 15125

Podregija države (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Država: Grčija

E-naslov: eproc-esender@eurodyn.com

Tel.: +30 2108094500

Vloge te organizacije:

TED eSender

10. Sprememba

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Glavni razlog za spremembo

:

Posodobitev informacij

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: angleščina

Številka objave obvestila: 488696-2026

Številka izdaje UL S: 134/2026

Datum objave: 15/07/2026